BEST AVAILABLE COPY

Reference (10)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-166037

(43) Date of publication of application: 29.08.1985

(51)Int.CI.

B01J 37/04 B01J 23/18 B01J 23/20 B01J 23/24 B01J 23/32 B01J 23/64 B01J 23/68 B01J 23/84 B01J 27/057 B01J 27/182 // C07C120/14

C07C121/32

(21)Application number: 59-

(71)Applicant: NITTO CHEM IND

019369

CO LTD

(22)Date of filing:

07.02.1984 (72)Inventor: SASAKI TOMU

NAKAMURA TOSHIO UCHIUMI HIROSHI MURATA HIROSHI

NAKAMURA YOSHIMI

(54) MANUFACTURE OF OXIDE CATALYST CONTAINING ANTIMONY **DEPOSITED ON SILICA**

(57)Abstract:

PURPOSE: To manufacture the titled catalyst having high activity and high strength by using honeycomb-grain size distribution type silica sol which is derived under the existence of two kinds of silica sol in the specified proportion whose average grain size is different, as the silica sol which is used for the preparation of slurry.

CONSTITUTION: In the method for manufacturing the titled catalyst obtained by heat- treating slurry at ≤7pH and ≥40° C in which Sb compound, multivalent metal compound and silica sol are contained as an essential component and thereafter drying and calcining the slurry, as the silica sol which is usd for the preparation of slurry, the

honeycomb-grain size distribution type silica sol which is derived under the existence of the following silica sols A, B in the following amount whose average grain sizes are different is used. The silica sol A is equivalent amount to 10W90wt% of total silica contained in the catalyst and the silica sol B is equivalent amount to 90W10wt% of total silica contained in the catalyst. However, when the average grain sizes of the silica sols A, B are assumed as $da(m\mu)$ and $db(m\mu)$ respectively, $5 < da < 50 m\mu$ and 0.1 < (da/db) < 0.9 are obtained. Thus, the titled catalyst having high activity and high strength can be manufactured.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application] [Patent number] [Date of registration] [Number of appeal against examiner's decision of rejection] [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] [Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 昭60-166037

@Int_Cl_4	識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和60年(198	85) 8月29日
B 01 J 37/04 23/18 23/20 23/24 23/32	102	7059-4 G 7059-4 G 7059-4 G 7059-4 G 7059-4 G				
23/64 23/68 23/84 27/057 27/182 // C 07 C 120/14 121/32	1 0 1	7059—4G 7624—4G 6674—4G 7059—4G 7059—4G 7451—4H 7451—4H	審査請求	未請求	発明の数 1	(全10頁)

図発明の名称 シリカ担持アンチモン含有酸化物触媒の製法

②特 関 昭59-19369

②出 顧 昭59(1984)2月7日

砂発 明 者 木 横浜市鶴見区東寺尾中台7-10 佐 中村 横須賀市大矢部 4-23-1 砂発 明 者 斂 雌 横浜市戸塚区中田町2425-18 砂発 明 者 内 海 洋 砂発 明 者 横浜市保土ケ谷区瀬戸ケ谷町298-8 田 袋 美 砂発 明 者 中村 川崎市中原区小杉殿御町2丁目104番地 日東化学工業株式会社 東京都千代田区丸の内1丁目5番1号 ØЩ 顧 人

明. 緞 誉

1. 発明の名称

シリカ担持アンチモン含有酸化物触媒の製法 2. 特許請求の範囲

(1) アンチモン化合物、多価金属化合物およびシリカゾルを必須成分として含むスラリーを調製し、該スラリーをpH 7以下、温度 4 0 で以上で熱処理したのち、乾燥および焼成してアンチモン含有酸化物触媒を製造する方法において、該スラリー調製に使用するシリカゾルとして、平均粒子径の異なる下記のシリカゾルAおよびBを下記の量で存在させることによつて誘導される多峰粒径分布型シリカゾルを用いることを特徴とする、強度の改善されたアンチモン含有酸化物触媒の製法。

シリカゾルA…触媒中の全シリカの10ないし

9 0 重量 9 相当量

シリカゾルB…触媒中の全シリカの 9 0 ないし 1 0 重量 5 相当量

ただし、シリカソルAの平均粒子径を da [mu]、 シリカソルBの平均粒子径を db(mu) とするとき $5 < da < 50 m\mu$

0. 1 < d = / db < 0. 9.

(シリカゾルAおよび/またはシリカゾルBは、 それぞれ2種以上のシリカゾル混合物であること をさまたげない)

- (2) シリカソルAおよびBの混合物をあらかじ め調製した後にアンチモン化合物,多価金属化合物をよび該シリカソル混合物からスラリーを開製 する特許請求の範囲第1項記載の方法。
- (3) pH 調整前のスラリー調製工程中にシリカソルムおよびBを別々にかつ独立してアンチモン化合物および/または多価金属化合物と混合する特許策の範囲第1項記載の方法。
- (4) レリカソルAまたはBの一部または全部を アンチモン化合物および/または多価金属化合物 と混合し、次いで残余のシリカソルBおよび/ま たはAをこれに添加してスラリーを調製する特許 請求の範囲第3項記載の方法。
- (6) レリカゾルAおよびBの一部をアンチモン 化合物および/または多価金属化合物と混合し。

特問昭60-166037(2)

次いで残余のシリカゾルA および B を これに 添加 してスラリーを調整する特許 請求の範囲第 3 項記、 載の方法。

- (6) 乾燥を噴霧乾燥法により行ない、これによって微細な球状粒子を形成せしめ、ついで、該粒子を200~600℃で仮焼成後、最終的に500~950℃で焼成する、特許請求の範囲第1項~第5項のいづれかに記載の方法。
- (7) 多価金属化合物が、鉄、コパルト、ニッケル、鍋、ウラン、クロム、鍋、マンガン、チタン、パナジウム、モリブデン、タングステン、テルル、ビスマス、ヒ果、トリウムかよびセリウムからなる群から超ばれた少なくとも一種の元素の化合物である特許請求の範囲第1項~第6項のいづれかに記載の方法。
- (B) 触媒の組成が、下記の実験式で示される。 特許請求の範囲第1項~第7項のいずれかに記載 の方法。

Me a Sbb Xe Qd Re O! (8iO2)g ただし上記式中において、

なお、今は酸素原子を表わし、「は各成分元素が結合して生成する酸化物に対応する酸素原子の数を示す。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、シリカ担持アンチモン含有酸化物酸 媒の製法の改良に関する。特に本発明は、有機化 合物の酸化、アンモ酸化および、または酸化脱水 素反応用触媒の製造法に関する。

有機化合物の酸化。アンモ酸化および、または 酸化脱水素反応用触媒としては多くのものが知られている。

とくにアンチモン含有触線としては、特公昭37-13460号公報記載のアンチモンと錫の酸化物組成物、特公昭38-19111号公報記載のアンチモンと鉄、コパルトかよび、またはニッケルとの酸化物組成物、特公昭40-24367号公報記載のアンチモンとウランの酸化物組成物などがあり及好な性能を与える。

これらの触媒は,多くの場合,担体。例えばシリカ,アルミナ,チタニアなどに担持されて用い

Me=Fe. Co, Ni, Sn. U, Cr. Cu, Mn. Ti. Th. および Ceからなる群から選ばれた少なくとも一種の元繁

X = V. Mo, および W からなる群から避ばれた少な くとも一種の元素

- Q = Li, Na, K. Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Y,
 La, Tb, Zr, Hf, Nb, Ta, Re, Ru, Os, Rh, Ir,
 Pd, Pt, Ag, Zn, Cd, Al, Ga, In, Tl, Ge, Pb,
 As かよび Se からなる 群から 速ばれた少なく
 とも一種の元素
- R=B, P, Te, およびBiからなる群から選ばれた 少なくとも一種の元素

添字a,b,c,d.e!およびgは原子比を示し,それぞれ次の範囲にある。

 $a = 5 \sim 15$

b = 5 ~ 1 0 0

c = 0 ~ 1 5

 $d = 0 \sim 20$

e = 0 ~ 1 0

g = 1 0 ~ 2 0 0

られる。この目的の一つは、触媒に強度を与えることである。このような目的の先行技術としては 特公昭 4 2-2 2 4 7 6 号公報、特公昭 4 7-1 8 7 2 2 号公報、特公昭 4 7-1 8 7 2 3 号公報などに記載の アンチモン含有酸化物触媒の製法がある。

しかし、従来の方法は、良好な活性および物性を有する触媒を製造するためには、必ずしも満足すべきものではなかつた。この系統の触媒ではとくに触媒強度の点で問題が多く、流動床触媒の場合は一層問題が多かつた。

洗動床反応では、反応中の触媒ロス(系外飛散)が増大し、定常的な運転が難しくなつたり、そとまで行かなくとも、触媒原単位の悪化により、目的生成物の製造コストが増大したりする。

特開昭 5 8-11045 号公報には、アンチモン酸塩ペースの酸化物触媒を製造する際、担体材料としてフュームトンリカシよびシリカゾルを混合して用いる方法が提案されている。これにより優れた触媒特性と、より優れた耐摩耗性を示すアンチモン酸塩触媒が調製できるとしている。

特開昭60-166037(3)

しかし、フュームドシリカは非常にかさ高で取り扱いにくい粉体であるうえ、これをシリカゾルに混合して用いると、かさ密度、粒子密度が小さく、破砕強度が小さい触媒となる。触媒製造上も、触媒使用上も新たな問題が種々発生する。

かさ密度の小さいシリカゲルの製法として粒子 径の異なるシリカゾルを混合して用いるという提 案が米国特許第 3,3 9 7,1 5 3 号明細質に配されてい る。そして、該米国特許の突施例の一つには、リ ン、モリブデン、およびピスマスを含有するシリ カ但持の固定床触媒の製造例が示されている。

しかし、流動床触媒の場合は、かさ密度が小さ すぎると触媒ロスが増大するし、かさ密度が大き すぎると流動化状態が悪化し、いずれも好ましく ない。目的により適度なかさ密度を与えることが 望ましい。そのうえて、十分な強度を与えること が肝要である。

上記米国特許では、強度の点にはふれていない し、ましてや本発明が対象とする強度の改善され たアンチモン含有酸化物触媒の製造に関しては何 らの示唆すら与えられていない。

上記の特開阳 58-110.45 号公報および米園特許第 3,3.97,153 号明細番に述べられている提案はいずれも、前述の特公昭 47-18722 号公報、特公昭 47-18723 号公報などに記載の方法を改良するものでもないし、本発明の方法を直接示唆するものでもない。

本発明は、前述のような従来技術の有する問題点を解決したものであり、活性の良好なしかも強度の大きいシリカ担持アンチモン含有酸化物触媒の製造法である。本発明はとくに流動床触線製造の場合に顕著な効果を示す。

更に群しくは本発明は、アンチモン化合物・多価金属化合物およびシリカソルを必須成分として含むスラリーを翻製し、該スラリーを pH 7 以下、温度 4 0 ℃以上で熟処理したのち乾燥および焼成してアンチモン含有酸化物触媒を製造する方法に関し、その特徴とするところは該スラリー翻製に使用するシリカソルとして平均粒子径の異なる下記のシリカソルムおよびBを下記の量で使用する

ことによって誘導される多峰粒径分布型シリカゾルを用い、これによって単峰粒径分布型シリカゾルを用いたときにえられる触媒に比較して強度の改善されたかつ少なくとも同等の良好な活性を保持するアンチモン含有限化物触媒を製造することにある。

シリカグルA…触媒中の全シリカの10~90 重量を相当量

ただし,シリカゾルAの平均粒子径をda[m4]. シリカゾルBの平均粒子径をdb[m4]とするとき.

5 < da < 5 0 m#

0. 1 < da/db < 0.9

(シリカゾルAおよび/またはシリカゾルBは、 それぞれ2種以上のシリカゾル混合物であること をさまたげない)

本発明の方法は、主としてシリカ担持のアッチモッ合有限化物触媒とくに流動床触媒の製造の場合効果的である。

触媒としては、その組成が次のような実験式で 示されるものが好んで用いられる。

Mea Sbb Xc Qd Re O!(8102)g ただし上記式中において、

Me=Pe, Co, Ni, Sn, U, Ct, Cu, Mn, Ti, Th かよび Ce からなる群から選ばれた少なくとも一種の一等

X = V, Mo, および W からなる群から選ばれた少なくとも一種の元素

Q = Li, Na, K, Rb, Cs, Be, Mg, Ca, Er, Ba, Y,
La, Th, Z[‡], Hf, Nb, Ta, Re, Ru, Os, Rh, Ir,
Pd, Pt, Ag, Zn, Cd, A&, Ga, In, T&, Ge, Pb,
As および8e からなる群から遅ばれた少なく
とも一種の元素

R = B, P, Te および Bl からなる群から選ばれた少なくとも一種の元素

添字a, b, c, d, e, fおよびgは原子比を示し、それぞれ次の範囲にある。

4 = 5 ~ 1 5

b = 5 ~ 1 0 0

c = 0 ~ 1 5

d = 0. ~. 2 0.

e = 0. ~ 1 0

 $g = 1 0 \sim 2 0.0$

なお、中は酸素原子を畏わし、fは、各成分元素が結合して生成する酸化物に対応する酸素原子の数を示す。

触媒の形状は、目的により適宜選択すればよい。固定層反応の場合には数量程度のベレット状、球状など種々の形状のものが用いられる。流動床反応の場合には、一般に5ないし200μの範囲の粒径の実質的に球状の触媒粒子が用いられる。

アンチモン化合物としては、金属アンチモンの 硝酸々化物、硝酸アンチモン、塩基性硝酸アンチ モン、三酸化アンチモン、四酸化アンチモン、五 酸化アンチモン、アンチモン酸、ポリアンチモン 酸、三塩化アンチモン、五塩化アンチモン。三塩 七子ンチモン、三塩化アンチモンの硝酸々化物、 三酸化アンチモンの適酸化水素酸化物、五酸化アンチモングルなど種々のアンチモン化合物を用い

mμであるが, 好ましくはるないし100mμ. とくに好ましくは5ないし50mμである。

レリカグルの粒子径は、表面積法、電子顕微鏡法、水酸化ナトリウム簡定法な要、公知の方法によつて知ることができる。

本発明の方法においては、アチモンとの方法においては、アチモンとの方法においては、アクリーのでは、アクルのでは、アクルのでは、アクルのでは

ることができる。

多価金属化合物とは、原子価が2以上の元系の化合物であり、触媒の構成元素から選択された少なくとも一種以上の元素の化合物である。該化合物はこれら元素の酸化物、水酸化物、硝酸塩などから適宜選択して用いれば良い。

その他の触媒成分原料についても、それぞれの 成分元素の酸化物、水酸化物、硝酸塩などから避 耳避択すれば良い。

シリカゾルは、市販のものから適宜選択して用いるのが便利である。シリカゾルはまたイオン交換法、ゲル解膠法、透析法、限外口過法など、公知の任意の方法により製造することもできる。

シリカグルの製造には、縮合重合反応によるケイ酸高重合分子の生成工程が含まれるが、その生成条件によつて、シリカ・コロイド粒子の粒径が決まる。一般に、その生成条件が一定であれば、一定の大きさの粒子となり、しかも粒子径分布は、およそ均一である。

シリカゾルの平均粒子径は、1ないし1000

- の乾燥後の任意の工程で、成型する。

PH 調整して加熱処理する際のスラリー中には、アンテモン化合物、多価金属化合物およびシリカソルの 3 者が同時に存在している必要がある。これら 3 者それぞれの一部分を、加熱処理のあとに加えることはできるが、 3 者のうちのいづれかの成分の全量を加熱処理のあとに加えたのでは、良好な物性の触媒は得られない。

触媒の製造法は、上記の他に種々の変形が可能 であるが、重要なことは、シリカソルとして粒子 径の異なる少なくとも 2 種のシリカソルを用いる ことである。

使用する第1のシリカゾルをシリカゾルA。第2のシリカゾルをBとしたとき、シリカゾルAを触媒中の全シリカの10ないし90重量をに相当する量で混合した用いる。

シリカゾルAおよびBのシリカ合量が同じ場合は、上記の数字は、そのままシリカゾルの混合割

合に等しくなる。

シリカゾルAおよびBの混合は、かならずしも、 あらかじめ行なり必要はない。上述の pH 調整前 のスラリー中に両者。すなわちシリカゾルAおよ びBが存在していればよい。従つてシリカゾルA およびBは別々にかつ独立してアンチモン化合物 および/または多価金属化合物と混合することが できる。たとんぱレリカゾルAの一部または全部 とアンチモン化合物。および多価金属化合物とを 混合して生成したスラリーにシリカゾルB(およ びシリカソルAの一部のみをあらかじめ使用した ときはシリカゾルAの残余の量)を加えることも できる。その他種々の混合方法をとることもでき る。 pH 調整前のスラリー中にシリカゾルAおよび B が存在する限り、シリカゾルA および B. アン チモン化合物ならびに多価金異化合物の添加順序 は臨界的ではない。

なお、ここで使用するシリカソルAの平均粒子 径を d m (m μ) 、シリカソルBの平均粒子径を d b (m μ)とするとき、 d m および d b は、次の条件が 満足されていることが好ましい。

5 < da < 5 0 m # .

0. 1 < d a / d b < 0. 9

(シリカソルAおよび/またはシリカゾルBはそれぞれ2種以上のシリカゾル混合物であることをさまたげない。)…

以上のようにして調製されたシリカ担持アンチモン含有酸化物触媒は、艮好な物性、活性を有する。

以下,本発明を突施例および比較例により説明する。

なお、実施例、比較例では、次のシリカゾルを 用いた。

		シリカ合量	粒子径	pН	粘	庻
		(* t #)	(ミリミクロン)		ζCP	ני
シリカゾル	I	2 0.1	8	8.5	1.9	ı
	U	2 0.0	1 3	3.2	2.8	1
	E	2 0.5	. 16	8.2	4.3	١.
•	[¥	2 0.0	4 5	3. 2	2. 5	i

流動床触線の強度試験は、次の2種類の方法を

用いた。

(1) 耐摩耗性試験

流動接触分解放集の試験法として知られている "Test Methods for Synthetic Cracking Catalysts" Amesican Cyanamid Co.Ltd. 6/31-4m-1/57記載の方法に準じて行なつた。 摩兹損失(多)は、次式により求めたものであ

ただし、A = 0.~ 5 時間に摩城損失した触媒の 重量(f)

B = 5 ~ 2 0 時間に摩減損失した触媒の政告(2)

C=試験に供した触媒の重量(f)

たか、この試験は、C= 5 0 で行なつた。 耐靡耗性の大きい触媒ほど、この學斌損失例 R値は小となる。

(2) 破砕強度試験

マイクロメツシュシーブにより 篩別し、 3 °5 ~ 4 °0 μの範囲の触媒をとる。

粉砕後のサンブルの粒径分布を測定し、酸砕により 1 6. A 以下となつた量の仕込み量に対する割合K(*)を求める。

強度の大きい触線ほど、とのK値は小となる。 流動床触媒の活性試験は、プロピレンのアンモ 酸化反応を代表例とし、次のように行なつた。

触媒流動部の内径が 2.5 cm, 高さ 4.0 cm の流動 床反応器に触媒を充填し、次の組成のガスを送入 した。

反応圧力は常圧である。

O₂(空気として供給)/プロピレン= 2.2 (モル/モル)

NH 1/プロピレン= 1. 1(モル/モル) 実施例 1

実験式が、We.s Moo.s Tel.4 Cu. Fell 8bss。 Ors.4 (8iOs) soである触媒を、次のようにして器 製した。

電解鉄粉 6 8.4 9をとる。硝酸(比重 1.3 8) 0.6 3 2 を, 純水 0.6 6 2 と混合し加温する。 これに電解鉄粉を少しずつ加える。完全に溶解したことを確認する。

硝酸銅107.59をとる。これを上記硝酸鉄溶液に加え溶解させる。

この鉄、銅硝酸溶液だ、シリカソル 1 を 9 8 8 9 シリカソル 1 を 1003 9 順次加える。

三酸化アンチモン4058をとり、上記溶液に加える。

15 ダアンモニア水を少しずつ加え, pHを 2 に観整する。

このスラリーを加熱し、9504時間加熱する。パラタングステン酸アンモニウム 5.89, パラモリブデン酸アンモニウム 9.89 およびテルル酸 35.89をとり、これらを純水 5.00 ml に容解する。この液を、さきに闘製したスラリーに加え、よく攪拌したのち、噴器乾燥する。

噴霧乾燥により得られた球状粒子は, 2 0.0 C

4 時間, 4 5 0 ℃ 4 時間焼成したのち, 最終的に 7 8.0.℃ 4 時間焼成する。

実施例 2·

ンリカゾル1 および I の代りに、シリカゾル I および I を用いた以外は、実施例 1 と同様に して 触媒を製造した。

たゞし、シリカゾルⅡ、 t 0,0.3g、シリカゾル Ⅱ、 9799を用いた。

哭旅例3

シリカグル1かよび『の代りに、シリカグル』 および『を用いた以外は、実施例』と同様にして 触媒を製造した。

ただし、シリカゾル E、 15059、シリカゾル E、 4899を用いた。

哭旅例 4

シリカゾルIおよび』の代りに、シリカゾル」 および』を用いた以外は、実施例」と同様にして 触媒を製造した。

ただし、シリカソル I、 9989、シリカソル 🛚 . 9799を用いた。

宴施卿

シリカゾル「および」の代りに、シリカソル「および『を用いた以外は、実施例」と同様にして 触媒を製造した。

ただし、シリカゾルI、14979、シリカゾルIV、5029を用いた。

突施例 6

実験式が、Moo.s Tels Cu4.s Feli Sb2s O75.5.
(8102) 50 である触媒を次のようにして翻製した。

電解鉄粉 7 8.2 9をとる。硝酸(比重 1 3 号) 0.5 9 8を, 純水 0.7 4 8 と混合し加温する。これに電解鉄粉を少しずつ加える。完全に溶解したことを確認する。これに金属テルル粉 2 2.8 9を加え密解させる。

硝酸銅1299をとる。これを上配硝酸鉄榕被 に加え榕解させる。

この飲・テルル・銅溶液に、シリカゾル I、4 4 5 9 を加え、ついでシリカゾル I、13 4 2 9 を加える。

三酸化プンテモン4349をとり、上記熔板化

加える。

パラモリブデン酸アンモニウム10.5gを, 純水 0.1 l に容解し、上記スラリーに加える。

15 f アンモニア水を少しずつ加え。 pH を 2 に調整する。

このスラリーを加熱し、100℃ 3.5 時間加熱 する。

加熱処理の完了したスラリーを、よく提拌しつ つ噴務乾燥する。

噴霧乾燥により得られた球状粒子は、200℃ 4時間、400℃4時間焼成したのち、機終的に790℃3時間焼成する。

比較例」

突跑例 1 と同様にして、ただし、シリカゾルとしては、シリカゾル 1 のみ 1 9 9 6 9 用いて触媒を製造した。

比較例 2

実施例 1 と同様にして、ただし、シリカゾルとしては、シリカゾル 1 のみ 1 9 5 7 9 用いて触媒を製造した。

比較例3

実施例 6 と同様にして、ただし、シリカゾルとしては、シリカゾル E:のみ 1:7.8.9 5 用いて触媒を製造した。

これらの実施例および比較例によってえられた 触媒の物性測定結果を第1:表に、活性試験結果を 第2:表にそれぞれ示す。

第 1 表 物 性 鄭 定 結 果

		使	用シリメ	1/1	放棄の	**	# W	佐
		復合	朝台	粒径比	是終婚成品度	かる密度		放皮
1		A	В	40/40	(3)	(9/26)	影摩托佐	政办法定
		₩ŧ≸	₩L≸		(\$hr)	想から歯変	B做	K 🛍
SASSA	7 1] 50	1 50	Q 6 2	780	1,23	0, 5	220
,	2	1 50	# 5 0	0.8 1	780	1.1 8	0.7	2 2 2
	3	1 75	Д 25	Q8 1	7 8 0	L18	0.5	2 6.5
,	4	· [5 0	п 50	0.5 0	780	L16	0.6	211
,	5	1 7 5	¥ 2 5	0.18	780	1.2 5	a.4	28.1
	6	1 2 5	75	0.6 2	790	122	0.4	20.1
HARM	11.	1 0 3	使用		780	L'18	0.7	3 6.1
•	2	I O A	使用		7 5 0	114	0.9	3 9. 3
•	3	IOS	使用		790	1.20	0.6	8 8.5

第 2 数 活性 試験 結果

	反応温度	接触時間	アクリロニト	實際収率	プロピレン全
	t	, arec	リル収率が	*	転化率≠
哭施例 2	4 3 5	4.0	8 3.2	4.8	9 8.5
夹施约3	435	4.0	8 3.0	4, 9	9 8.9
比較例 2	435	4.0	8 3.0	4.6	9 8.3

手 統 楠 正 書

昭和 6 0年 1月 /8 日

特許庁長官 志 賀 学 関

1. 事件の表示

昭和 5 9 年 特許 顯第 1 9 3 6 9 号

2. 発明の名称 シリカ担持アンチモン含有酸化物触媒の製法

· ·

3. 補正をする者

事件との関係 特許出顧人 〒100 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 (395) 日東化学工業株式会社

All the state of the same of the

補正命令の日付 自 発

5. 補正の対象

明維書の発明の詳細な説明の概

特際昭60-166037(8)

6. 補正の内容

- (1) 明細督第6頁11行目の「流動床反応では、 反応中の…」を「流動床反応では、とくに触 媒の強度は重要である。活性が良くても強度 が小さいと工業的には使用に耐えず、反応中 の…」に訂正する。
- (2) 明細書第7頁13行目の「すぎると触媒ロスが…」を「すぎると一般に強度が小さく。 反応系外へ飛散しやすいので触媒ロスが…」 に訂正する。
- (3) 明細警第10頁下から1行目~第11頁4 行目の記載を次のように訂正する。

b= 5~100 (好まし(は10~60) c= 0~ 15 (好まし(は0.1~10)

d= 0~ 20 (好ましくは0.1~10)

6= 0~ 10 (好ましくは0.05~5)

g=10~200 (好ましくは20~100)

(4) 明細番第13頁1行目~2行目の「… であるが、好ましくは3ないし100 mm. とくに 好ましくは…」を「…であるが、一般に安定 的なシリカゾルが得やすいと云うととでるないし100m4, 好ましくは…」に訂正する。

(5) 明細書第25頁第2表の後に、次の実施例。 比較例および設を加入する。

実施.例 7

突験式が、Feio Cois Nils Sha Wos Teis Bos O727 (SiO2) mである触媒を、実施例 1 と同様の方法により製造した。

ただし、Co. Ni 順料としては硝酸塩を、B原料としては無水ホウ酸を用いた。シリカソルは、 シリカゾル 1 および 1 を用いた。最終焼成は 816 で 3 時間とした。

奥施例8

実験式が、Fe₁₀ Sna₅ U₁ Sb₅₅ W_{0.5} Mo_{0.5} Zr_{0.5} Ga_{0.5} Te_{1.0} Bl_{0.5} O_{74.5} (SiO₅) so である触媒を、実施例 1 と同様の方法により製造した。

ただし、Sn 原料としては金属銀を硝酸々化し、u 原料は硝酸ウラニル、W はパラタングステン酸アンモニウム、Zr はオキン硝酸 ジルコニウム、Ga 原料は硝酸ガリウム、Te 原料はテルル酸、Bi 原料は硝酸ピスマスをそれぞれ用いた。 シリカゾルは、シリカゾル 1 を用いた。 最終焼成は、190 C 4 時間行なつた。

実施例9

実験式が Fe to Cr 1 Sb 20 We 3 Nb 6.3 Ta 4.2 Pa 5 O 54.5 (SiO 2) to てある触媒を、実施例 1 と同様の方法により製造した。

ただし、Cr 原料としては硝酸クロム、Nb 原料としては蓚酸ニオブ、Ta 原料は 5 酸化タンタル、P 原料はリン酸をそれぞれ用いた。 シリカゾルは、シリカゾル I および I を用いた。 最終焼成は 850 で 3 時間行なつた。

実施例10

実験式が、Fe to Mn a Shao Moos Zno.s Bio.s Po.s Oss (SiOz) to である触媒を、実施例 1 と同様の方法により製造した。

ただし. Mn 原料, Zn 原料 および Bi 原料は 硝酸塩、 P 原料はリン酸をそれぞれ用いた。 レリカゾルは、 レリカゾル I および I を用いた。 最終 焼成は 8 2 0 ℃ 6 時間とした。

実施例 1 1

実験式が、FeiTisSbsoVeiAAliTeilOnes (SiOs)ssである触媒を、実施例1と同様の方法に より製造した。

ただし、Ti 原料は二酸化チタン、V原料はメタバナシン酸アンモニウム、A&原料は硝酸塩、Te 原料は二酸化チルルをそれぞれ用いた。シリカゾルは、シリカゾル & および ** を用いた。 最終焼成は、800 C 4 時間とした。

奥施例12

突験式が、Fe to Cu : Ni o.s 8 b as Wo.s Mo e.: P b o.s Te i.s O iso.i (SiO s) eo である触媒を、実施例 1 と同様の方法により製造した。

ただし、Ni 原料および Pb 原料は硝酸塩を、Te 原料はテルル酸をそれぞれ用いた。シリカゾルはおよび J を用いた。最終焼成は、770 ℃ 3 時間とした。

比較例 4

実験式が Fe to Co La N I La Sb zz Wes Te La Bos O 72.7 (SiOz) sa である触媒を実施例 5 と同様の方法により製造した。シリカソルは、シリカソル』のみを用いた。

比較例 8

実験式が、Feto Cu, Nios Sbss Wes Moos Phos Teis Otto (SiO2) to である触 無を実施例 1 0 と同様の方法により製造した。 シリカゾルは、シリカゾル I のみを用いた。

とれらの実施例 7~12 および比較例 4~9 K よつてえられた触媒の物性測定結果を第3 裂に、 活性試験結果を第4 裂にそれぞれ示す。

比較例 5

実験式が、Fe₁₀ Sn₀₃ U₁ Sb₂₃ W_{0.3} Mo_{0.3} Zr_{0.3} Ga_{0.3} Te_{1.0} Bi_{0.5} O_{74.8}(SiO₂)₂₀ である触媒を実施例 6 と 同様の方法により製造した。シリカゾルはシリカ ゾル狐のみを用いた。

比較例 5

突験式が、Fe₁₀ Cr₁ Sb₂₀ W_{0.5} Nb_{0.2} Ta_{0.3} P_{0.5} O_{B.5} (SiO₂)₆₀である触線を実施例 7 と同様の方法により製造した。シリカゾルは、シリカゾル I のみを用いた。

比較例 7

実験式が、Fam Mn. Sbm Moos Znos Bios Pos Om (8iO2)mである触媒を実施例 8 と同様の方法により製造した。シリカゾルは、シリカゾルIのみを用いた。

比較例8

突験式が、Fe₃ Ti₂ Sb₂₀ V_{0,3} AA₁ Te_{1.1} O_{00.5} (SiO₂)₅₂である触媒を実施例 9 と同様の方法により製造した。シリカゾルは、シリカゾル I のみを用いた。

	使用	· ?.	オンカ	酸蝶の最	**	禁	#
	混合割合	数令	校径比	林焼成温度	かる密度	五	被照
	₫	B	7,	(a)	(8/40)	耐摩耗性	政學強度
•	*	W 1.5	2 2 2		粗かさ密度	R值	KÆ
美施奶7	-	-					
	20	20	0.62	8 1 5	0.88	1.3	23.1
8	_	-					
	20	20	0.62	190	0.9 1	2.0	3 0.5
Ø	=	=	- , -				
	20	20	0.81	8 2 0	1.04	8.0	2 0.0
0 7 ,		Ä					
	20	50	0.81	8 2 0	0.90	1.9	34.1
1.1.	ä	=	A				
	20	20	0.8 1	800	0.97	20 .	2 7.5
. 12	***	=					
	20	20	0.8 1	770	0.89	42	3 88
五数图 4	0	の今使用		815	0.8 5	1.5	3 8.2
LO N	9	の多種		790	0.87	2	4 0.5
	9	「多種		9 8 0	1.0.1	1:1	2 2 0
	9	このを使用		8 2 0	0.82	4	4 9.6
	9	の多使用		008	\$6 0 V	84 89	8 0 8
6	0	このを使用		770		E #	5 1.7

第 4 表

活性 拭 験 结 果

	反応温度	接触時間 sec	アクリロニトリル収率 **	プロピレン全転化率 ダ
実施例 7	4 2 5	4.0	8 0.2	9 8.2
# ^{2'} 8	425	4.0	, 7 9.0	9 B.5
, 9	430	4.5	7 3.1	9 6.7
# 1 0	4 2 5	4. 5	7 4.1	9 7.0
# 1 L	430.	4.0	7 8.4	9 9.2
/ 1 2	430	8. 5	8 Ż. 1	- 9 9.5
比较例 4	4 2 5	4.0	8 0.0	9 7.9
₹ 5	425	4.0	7 8.8	9 7.3
<i>∗</i> €	430	4.5	7 0.9	9 5.0
. 7	4 2 5	4.5	7 3.1	9 5. 5
8	430	4.0	7 7.9	9 8.4
# 9	430	3.5	. 80.9	9 8.7

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.